

第十五届全国薄膜技术学术研讨会

会议指南

主办单位：中国真空学会薄膜专业委员会

承办单位：浙江大学

支持媒体：《真空科学与技术学报》、《真空与低温》、《真空》、中国真空网

浙江*杭州

2019.11.15-2019.11.18

一、报到注册

1、报到：

时间：11月15日 10:00-21:00

地点：杭州宝盛宾馆，浙江省杭州市萧山区市心中路618号

2、报到流程：

(1) 现场注册，缴费时请正确填写并校对注册信息、发票抬头和邮寄地址，会议期间凭收据换取发票或会后统一邮寄，凭收据领取会议资料。

(2) 已预订酒店的代表请先核对酒店信息，凭身份证和代表证登记入住；未预定酒店的代表自行安排住宿。

3、会议收费：

(1) 会议注册费：一般代表1200元，学生代表800元（凭有效学生证），报到时现场注册缴费（已经通过汇款缴费的代表直接注册）。

(2) 大会特邀报告代表免收会议注册费。

(3) 企业参展和论文集广告收费联系会议组委会。

(4) 会议代表交通、住宿费用自理，15日组委会提供晚餐，16-17日提供餐饮，18日不提供餐饮。

二、学术活动安排

1、大会以及分会会场均设在杭州宝盛宾馆（浙江省杭州市萧山区市心中路618号），会议日程具体安排如下：

时间	内容	地点	参加人员	
11月15日	全天	会议报到、注册	参会人员	
	18:00-21:00	自助晚餐	参会人员	
11月16日	08:30-08:50	开幕式	参会人员	
	08:50-10:20	大会邀请报告		
	10:20-10:50	合影、茶歇		
	10:50-12:00	大会邀请报告		
	12:00-13:30	午餐（自助餐）		
	13:30-15:35	分会场1		二楼心悦厅
		分会场2		二楼八珍轩
		分会场3		二楼龙光阁
	15:35-15:50	茶歇、参观企业展位		二楼大厅
	15:50-18:00	分会场1		二楼心悦厅
		分会场2		二楼八珍轩
分会场3		二楼龙光阁		
18:00-20:00	晚宴	八楼宝盛厅		
11月17日	08:30-10:15	分会场1	参会人员	
		分会场2		
		分会场3		
	10:15-10:30	茶歇、参观企业展位		
	10:30-12:00	分会场1		

		分会场 2	二楼八珍轩	
		分会场 3	二楼龙光阁	
	12:00-14:00	午餐	一楼钱塘轩	
	14:00-15:30	大会特邀报告	二楼金玉堂	
	15:30-15:45	茶歇、参观企业展位	二楼大厅	
	15:45-16:45	大会特邀报告	二楼金玉堂	
	16:45-17:15	闭幕式（颁奖仪式）	二楼金玉堂	
	17:30-19:30	晚餐（自助餐）	一楼钱塘轩	
11月18日	全天	大会离会		参会人员

2、大会报告具体安排：

11月16日	08:30- 08:50	开幕式
	第一场	主持人：韩高荣
	08:50-09:20	移动通讯滤波材料与器件技术 清华大学 潘 峰
	09:20-09:50	硒化铽薄膜太阳能电池 法国雷恩第一大学 章向华
	09:50-10:20	有机发光二极管的应用与制备技术 苏州大学 廖良生
	10:20-10:50	茶歇（大会合影）
	10:50-11:20	第三代半导体发展报告 国家科技部高新司材料处原处长 徐禄平
	11:20-11:50	忆阻器材料及器件研究 华中科技大学 缪向水
	11:50-12:00	磁控溅射沉积技术的应用 广东生波尔光电技术有限公司 安继伟
	12:00-13:30	午餐（自助餐）
11月17日	第二场	主持人：任 妮
	14:00-14:30	新型氧化物镀膜玻璃的制备、结构与性能研究 浙江大学 韩高荣
	14:30-15:00	米级二维单晶材料的生长及性质调控 北京大学 刘开辉
	15:00-15:30	5G 通信用薄膜滤波器研究现状及多层膜的仿真分析 国家纳米科学中心 李红浪
	15:30-15:45	茶歇
	15:45-16:15	薄膜结构与性能准确测量 中国计量科学研究院 任玲玲
	16:15-16:45	反铁磁薄膜材料与高密度信息存储 清华大学 宋 成
	16:45-17:15	闭幕式（颁奖仪式）
	17:30-19:30	晚餐

3、分会场报告具体安排：

【分会场 1 主持人：任妮、汪爱英、于广华、赵斌】

日期	时间	报告名称	报告人	
11 月 16 日	13:30-13:55	基于声表面波技术的微型氧气传感器研制	吴卫东	
	13:55-14:15	不同工艺对 TiN 薄膜性能影响规律研究	刘星	
	14:15-14:35	原子层沉积制备新型薄膜材料	王新炜	
	14:35-14:55	ITO@WO ₃ 纳米晶复合电致变色材料的探究	张艺翔	
	14:55-15:15	前驱体溶胶陈化时间对 AACVD 法制备 FTO 薄膜结构及光电性能的影响	李有多	
	15:15-15:35	塑料表面替代电镀铬 PVD 功能装饰涂层制备与性能	张栋	
	15:35-15:45	茶歇		
	15:45-16:10	可变带隙化合物薄膜材料 Zn(O,S)在 CIGS 薄膜电池与硅基异质结电池中的应用	刘玮	
	16:10-16:30	有机太阳能电池薄膜材料中的电荷转移态	郑子龙	
	16:30-16:50	原位电化学阻抗谱研究光照对钙钛矿太阳电池稳定性影响	张道博	
	16:50-17:10	钙钛矿太阳能电池中的光诱导游离离子及其与自由载流子的相互作用	韩昌报	
	17:10-17:30	溅射功率对 ZnM-gO 薄膜及其 CIGS 太阳电池影响	杜倩	
17:30-17:50	CsF 后处理对 CIGS 薄膜电池的影响	程世清		
17:50-18:10	基于 Ag 掺杂的 CIGS 薄膜背梯度研究	张运祥		
11 月 17 日	08:30-08:55	利用磁控溅射技术在钛合金制备多层素 CrN 薄膜的性能研究	周艳文	
	08:55-09:15	偏压对高功率磁控溅射 CrAlN 阻氢薄膜结构及性能影响	巩春志	
	09:15-09:35	电场增强阴极弧放电 TiSiCN 薄膜结构及性能研究	孔营	
	09:35-09:55	磁场对中频溅射阴极刻蚀作用机理研究	何云鹏	
	09:55-10:15	离子束辅助沉积 ZnS 薄膜及后处理技术研究	李绵	
	10:15-10:25	茶歇		
	10:25-10:45	Mg/Ag 共注入修饰 TiN 的细胞及抗菌性能研究	韩笑	
	10:45-11:05	多孔碳材料的多巴胺电化学传感及其超声稳定性研究	王舒远	
	11:05-11:25	CVD 制备石墨烯薄膜的工艺条件对其中 C-Hn 存在的影响	袁良川	
	11:25-11:45	Concentration modified electrical and optical properties of sputtered binary SnO ₂ -Al ₂ O ₃ thin films on slide glasses	李院院	
11:45-12:05	含氢碳薄膜/Au 复合超滑机理	贾倩		

【分会场 2 主持人：田修波、李德军、刘玮、任玲玲】

日期	时间	报告名称	报告人
11 月 16 日	13:30-13:55	金属纳米颗粒膜表面等离激元共振强阻尼体系构建及应用	方应翠
	13:55-14:15	基于表面等离子激元效应的铝纳米颗粒的制备与分析	赵志伟
	14:15-14:35	稀土掺杂 SnO ₂ 薄膜制备及晶体管应用	任锦华
	14:35-14:55	微孔金属化沉积工艺中粒子传输特性研究	钱都
	14:55-15:15	电弧离子镀 MCrAlY 高温防护涂层及改性研究	石倩
	15:15-15:35	相变薄膜材料的面内热导率测试研究	杨冠平
	15:35-15:45	茶歇	
	15:45-16:10	宏观尺寸固体超滑及空间应用	张斌
	16:10-16:30	单层 MoS ₂ 表面二维金属钼纳米片的原位电镜研究	丁德恭
	16:30-16:50	Structurally defined graphene nanoribbon thin films for electronic device	陈宗平
	16:50-17:10	Ag/氧化石墨烯/TiO ₂ 纳米棒阵列薄膜的制备及增强的光催化、SERS 活性	王艳芬
	17:10-17:30	多层膜与单层膜的残余应力关系推导及验证	郭朝乾
	17:30-17:50	镍催化四面体非晶碳转化石墨烯机理研究	李汉超
17:50-18:10	织构化 Ti/Al 共掺杂类金刚石薄膜摩擦学性能的研究	徐晓伟	
11 月 17 日	08:30-08:55	纳米复合多层 ZnSb/GeSb 相变存储薄膜的性能与结构研究	吴卫华
	08:55-09:15	非晶碳薄膜载流子输运和压阻行为研究	郭鹏
	09:15-09:35	金属网栅电磁屏蔽窗口薄膜的设计与制备	王建
	09:35-09:55	用于氧还原反应的高耐久活性三元 Pt-Ti-Mg 薄膜电催化剂	刘广权
	09:55-10:15	化学气相沉积技术制备碳化镍与镍薄膜的研究	刘忠伟
	10:15-10:25	茶歇	
	10:25-10:45	Strong magnetoresistance modulation by the Ir-insertion in Ta/Ir/CoFeB trilayer	张瑞琪
	10:45-11:05	极化屏蔽诱导的 BiFeO ₃ /PbTiO ₃ 异质结外延生长及其界面磁性的研究	傅钢杰
	11:05-11:25	反铁磁 Mn ₂ Au 及其相关自旋力矩	周效枫
	11:25-11:45	二维 MoSe ₂ 薄膜中反向畴界的电镜表征与分析	虞周斌
11:45-12:05	铁电氧化物异质结界面铁磁性	陈嘉璐	

【分会场3 主持人：赵志伟、方应翠、马飞、罗景庭】

日期	时间	报告名称	报告人
11月 16日	13:30-13:55	纳米结构碳薄膜结构调控及在发动机方面的应用	张俊彦
	13:55-14:20	IGZO/HfGdOx 薄膜晶体管的制备及在逻辑电路中的应用	何刚
	14:20-14:40	高分辨透射电子显微镜原位表征单层黑磷边缘结构和重构	姚奋发
	14:40-15:00	磁控溅射制备本征绒面 Ga 掺杂 ZnO 薄膜及其在钙钛矿电池器件中的应用模拟	陈义川
	15:00-15:20	二氧化钛纳米纤维-纳米管分层结构及其光电性能	张苗
	15:20-15:40	sp ² 含量与团簇尺寸调控对非晶碳薄膜光电性能的影响	李昊
	15:40-15:45	茶歇	
	15:45-16:10	忆阻类脑器件及其神经形态运算	杨蕊
	16:10-16:30	基于氧化物异质结的人工光电神经突触研究	高双
	16:30-16:50	阻变存储器中金属导电细丝的形态调控	孙一鸣
	16:50-17:10	多孔 MoS ₂ 薄膜的制备及其储锂性能研究	邓文昕
	17:10-17:30	The Flexible and Multifunctional PANI Electrochemical film based on highly stable Ag@Pt AHNW Transparent Electrode	周开岭
	17:30-17:50	Nb:AlNO 薄膜的双动力学调控阻变机理及其学习行为的模拟	万钦
17:50-18:10	利用 PEDOT:PSS/ HfOx 双层忆阻器实现电突触和化学突触串联	刘佳璐	
11月 17日	08:30-08:55	三维有序多孔网络状 VO ₂ 薄膜的制备及其光学特性调控	马飞
	08:55-09:15	管内壁诱导电爆法制备柱状 TiZrV 薄膜的探讨	张心强
	09:15-09:35	过渡层对铝合金表面类金刚石薄膜结合失效行为的影响	周佳
	09:35-09:55	真空镀膜工艺在塑料工件表面处理中的应用	赵凡
	09:55-10:15	气致变色薄膜的研究进展和应用	祁万钰
	10:15-10:25	茶歇	
	10:25-10:50	Preparing of the copper-containing Film with the controllable Cu ²⁺ releasing profile on stent during the process of endothelialization	刘恒全
	10:50-11:10	聚变堆真空室领圈 316L 电子束焊接头力学行为分析	凌堃
	11:10-11:30	单晶合金 NiCoCrAlYHfDy 涂层 1200°C氧化行为研究	蔡妍
11:30-11:50	氩等离子预处理及 Si 中间层改善丁腈橡胶表面碳薄膜膜基结合强度及摩擦学性能	强力	
11:50-12:10	硅异质结太阳能电池非晶硅钝化层制备工艺研究	何永才	

三、报告准备

请作报告的代表注意查看分会场日程安排，确认报告具体时间，并于第一个报告开始前 10 分钟，将文件拷入会场专用电脑，会议结束后统一删除。代表也可以使用自己的电脑，烦请自备转接线。

四、展位

会议赞助商展位位于二楼大厅，请各位参展商于 11 月 15 日联系会议方刘敏强 13910180242，商量展位布置事宜，欢迎莅临参观。

五、餐饮服务

代表在参会期间仅凭餐券到指定地点用餐，餐券遗失不补。用餐说明如下：

- 1、早餐：06:30-10:00，杭州宝盛宾馆一楼钱塘轩（仅限本酒店住宿代表）
- 2、午餐、晚餐：15 日晚餐，16 日午餐、晚餐，17 日午餐、晚餐，一楼钱塘轩就餐。

六、酒店信息

杭州宝盛宾馆，联系人：王公 13655713043。

七、交通服务

1、会议期间交通安排

因参会代表人数比较多，会议不提供接机、接站服务，请代表自行前往会议地点。如有什么疑问请联系会务。

- a) 杭州东站至会议地点：16 公里，打车约 50 分钟，预计 70 元左右。
- b) 杭州萧山机场至会议地点：22 公里，打车约 50 分钟，预计 80 元左右。

八、会务组联系方式

工作人员	联系电话	工作职责
刘敏强	13910180242	会议统筹
王瑞	13263457400	负责财务、注册、住宿、餐饮等相关事务

友情提示

请自觉遵守会议纪律，服从会议安排，按时参加会议和相关活动，开会期间将手机关闭或设置振动状态。请妥善保管代表证及会议资料等，出入会场是请佩戴代表证。

会务组工作人员将竭诚为您服务。

致谢

“第十五届全国薄膜技术学术研讨会”即将在浙江省杭州市召开，我谨代表本次会议组委会衷心感谢所有为本次会议辛勤工作的人。

预祝本次会议取得圆满成功。

第十五届全国薄膜技术学术研讨会组委会